

日本写真学会 アンビエント技術研究会 第18回 開催の案内

2015. 7. 29

日本写真学会アンビエント技術研究会

主査：半那純一(東京工業大学)

低分子の有機半導体の電荷移動度などはその結晶構造や、単結晶/多結晶などの構造に依存することがよく知られ、また、単結晶を生成するための種々の手法も研究されています。しかしながら、工業的なレベルでの結晶成長を達成するには、速度がどのような条件に依存しているのか、乾燥過程でなにが起きているのかを工学的に知る必要があります。第18回の研究会では、晶析や乾燥の研究をされている化学工学の研究者に基礎からデータを解説していただき理解を深めたいと考えました。いつも通り、十分に時間を取っておりますので、しっかり議論ができればと思います。是非、奮ってご参加ください。多くのご参加をお待ちしております。

1. 日時：平成27年8月28日(金) 14:00~17:00
2. 場所：東京工芸大学中野キャンパス 芸術情報館3階 中会議室
3. 東京工芸大学中野キャンパスへのアクセス情報
 - 所在地：東京都中野区本町2-4-7
 - 最寄駅：東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線「中野坂上駅」下車
1番出口より徒歩約7分
 - 地図：<http://www.t-kougei.ac.jp/guide/campus/>

4. 参加費：無料

5. 参加申込

日本写真学会事務局アンビエント技術研究会係まで、E-mail か Fax にて申込下さい。

(一社)日本写真学会 事務局

〒164-8678 東京都中野区本町2-9-5 外線 03-3373-0724

E-mail spstj@pht.t-kougei.ac.jp Fax 03-3299-5887

6. 議題

1) 技術内容の紹介と議論

【第18回研究会技術テーマ】テーマと講師

(1) 「有機化合物の結晶析出挙動」

講師：大嶋 寛先生

(大阪市立大学大学院工学研究科化学生物系専攻)

(2) 「塗布乾燥薄膜の物性制御-固相析出と構造形成」

講師：辻 佳子先生

(東京大学大学院工学研究科化学システム工学専攻)

2) 第4回アンビエント技術セミナーの実施計画について

3) 次回研究会予定について

以上